

06.2

© 1991

О МЕХАНИЗМАХ ПАРАЗИТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ПОДЛОЖКЕ В $GaAs$ ПТШ

В.А. Г е р г е л ь, Э.А. И л ь и ч е в,
А.И. Л у к ь я н ч е н к о, Э.А. П о л т о р а ц к и й,
К.С. Ш а м х а л о в

Несмотря на обилие работ, посвященных исследованию эффектов паразитного управления по подложке (ЭУП), катастрофически влияющих на выход годных ИС на арсениде галлия, не существует ясных представлений о механизмах и кинетике этих явлений и методах борьбы с ними.

Для выяснения механизмов ЭУП в настоящей работе в диапазоне электрических полей $10^1\text{--}5\cdot10^5$ В/см и температур 300–450 К в статическом и динамическом режимах проведены комплексные исследования ЭУП полевых транзисторов Шоттки (ПТШ) на стандартных полуизолирующих подложках $GaAs$, легированных хромом (АГЧГ-4, 5). В процессе измерений токов стока и подложки при различных электрических полях и температурах выявлены

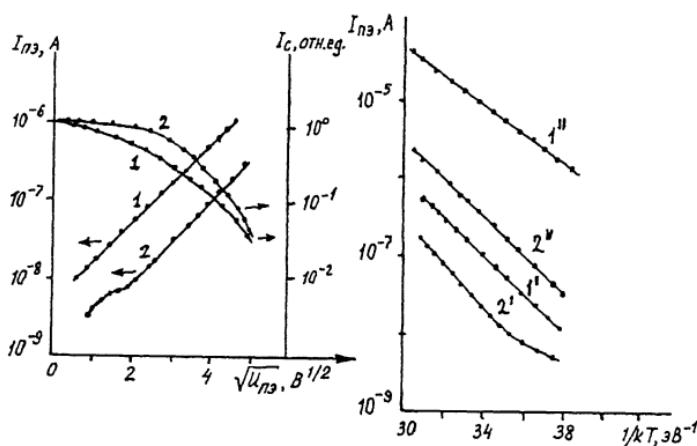


Рис. 1. а) Зависимости тока подложки и стока от напряжения на ПЭ, $T=298\text{K}$. 1 – беспороговые ЭУП, 2 – пороговые ЭУП. б) Температурные зависимости для тока подложки при различных напряжениях на ПЭ: 1', 1'' – беспороговые ЭУП, $U_{n3}=-1$ В и $U_{n3}=-25$ В соответственно; 2', 2'' – пороговые ЭУП с $U_{n3}=-4$ В и $U_{n3}=-6$ В соответственно (пороговое напряжение, U_{n3}^* , равно -4 В).

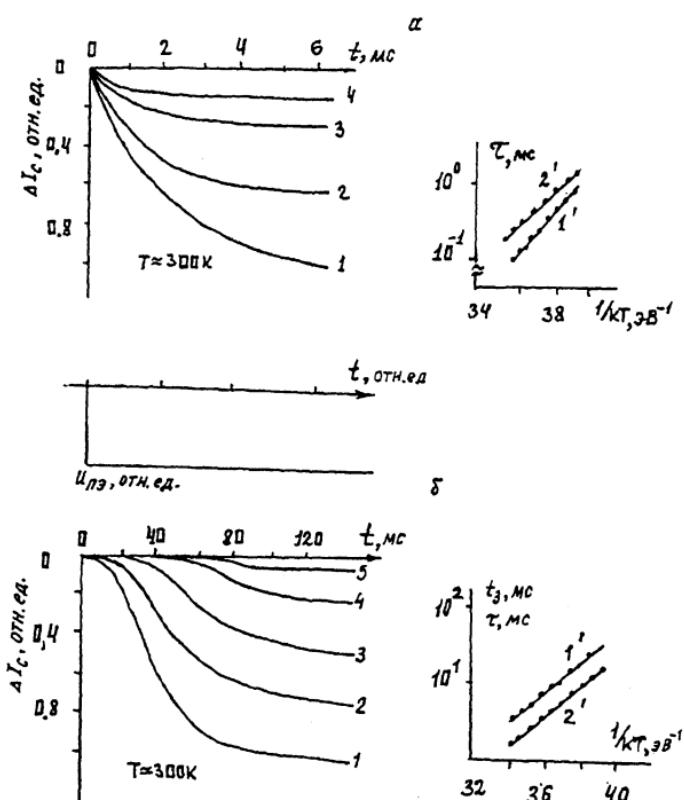


Рис. 2. Временная диаграмма тока стока и температурная зависимость времени релаксации тока стока при импульсном характере напряжения на ПЭ: а) беспороговые ЭУП: 1 - $U_{\text{пз}} = U_{\text{отс}}$, 2 - $U_{\text{пз}} = -0.8 \cdot U_{\text{отс}}$, 3 - $U_{\text{пз}} = 0.3 \cdot U_{\text{отс}}$, 4 - $U_{\text{пз}} = 0.15 \cdot U_{\text{отс}}$; 1' - $U_{\text{пз}} = 0.9 \cdot U_{\text{отс}}$, 2' - $U_{\text{пз}} = 0.2 \cdot U_{\text{отс}}$; б) пороговые ЭУП: 1 - $U_{\text{пз}} = U_{\text{отс}}$, 2 - $U_{\text{пз}} = 0.8 \cdot U_{\text{отс}}$, 3 - $U_{\text{пз}} = 0.7 \cdot U_{\text{отс}}$, 4 - $U_{\text{пз}} = 0.5 \cdot U_{\text{отс}}$, 5 - $U_{\text{пз}} = 0.3 \cdot U_{\text{отс}}$, где $U_{\text{отс}}$ - напряжение на ПЭ, перекрывающее канал ПТШ; 1' - $\tau(T)$, 2' - $t_3(T)$, 1', 2' - $U_{\text{пз}} = 0.9 \cdot U_{\text{отс}}$.

два основных типа проявлений ЭУП: ЭУП с беспороговыми и пороговыми характеристиками.

Для беспороговых ЭУП (рис. 1, кривые 1) установлено, что причиной модуляции проводимости канала ПТШ является накопление отрицательного заряда в подложке вблизи границы раздела канал-подложка из-за эмиссии дырок с ловушек с энергией ~ 0.7 эВ по механизму Френкеля-Пула ($q \cdot \beta_{PF} \approx 4-7 \cdot 10^{-4}$ эВ $^{-1}$ В $^{-1/2}$ см $^{1/2}$). Анализ процессов релаксации тока стока при импульсном характере напряжения на паразитном электроде (ПЭ) в условиях различных температур образцов выявил активационный характер процессов релаксации тока стока. С учетом деформации потенциала ловушек в сильных электрических полях показано, что и в динамическом режиме

ток в канале ПТШ контролируется акцепторными ловушками с энергией 0.70–0.75 эВ (рис. 2, а).

При пороговых проявлениях ЭУП на зависимостях тока подложки от напряжения на паразитном электроде регистрируются участки с линейной и сильной полевыми зависимостями (рис. 1, кривая 2). Участок с линейной зависимостью для тока подложки соответствует области напряжений на ПЭ, практически не влияющих на ток стока, а ток подложки контролируется донорным центром с энергией ~ 0.33 эВ. На участке напряжений на ПЭ, соответствующих значительной паразитной модуляции проводимости канала ПТШ, зависимость тока подложки, как и в беспороговом случае, определяется эмиссией дырок с акцепторных центров с энергией ~ 0.7 эВ по механизму Френкеля – Пула, а накопление отрицательного заряда на акцепторах в окрестности границы раздела канал–подложка приводит к модуляции проводимости канала. В динамических характеристиках существование донорного центра проявляется в пороговых ЭУП во временной задержке основного процесса модуляции проводимости канала ПТШ, если напряжение на ПЭ превышает пороговые значения (рис. 2, б). Длительность задержки определяется соотношением времен генерационно-рекомбинационных процессов с участием глубоких доноров и акцепторов. Целенаправленный выбор глубокой донорной примеси может рассматриваться как способ повышения порогового напряжения ЭУП до значений, допустимых требованиями со стороны ИС.

Поступило в Редакцию
25 апреля 1991 г.